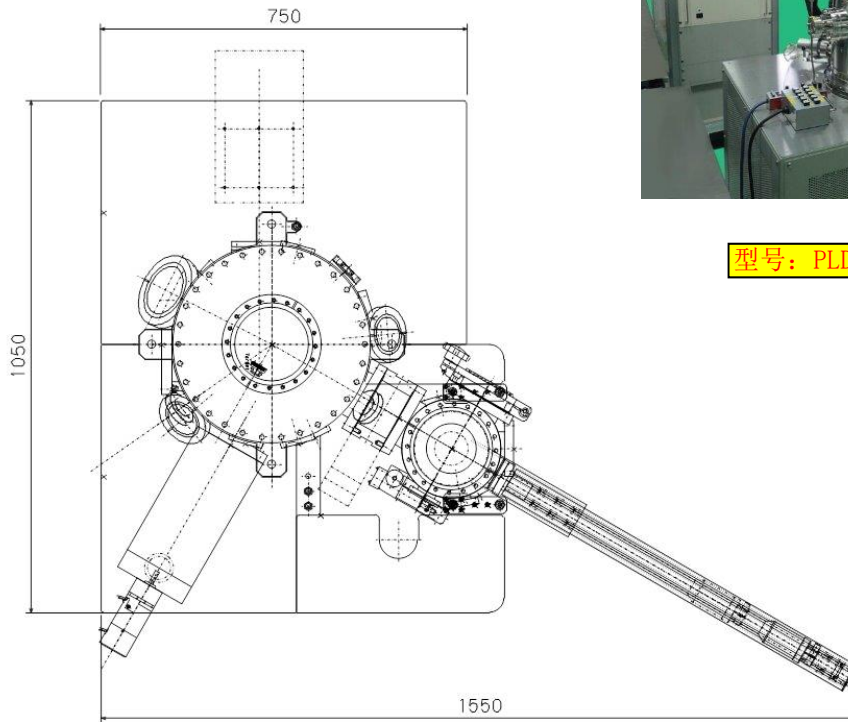


脉冲激光沉积系统

Pulsed Laser Deposition System



型号: PLD-203S-2



设备的详细指标及配置欢迎来电咨询

设备名称	脉冲激光沉积系统(Laser MBE 陶瓷加热)	备注
型号	PLD-203S-2 (镀膜室+准备室+RHEED)	
概要	镀膜室尺寸: 340 (ID) X500 (H) mm	电解抛光、外缠加热丝
	自公转靶: ϕ 1英寸 5个 (相互之间防污染)	尺寸数量可调整
	加热器: 抗氧化型陶瓷加热器、温度1200	可选择其它加热形式
	衬底: ϕ 1英寸, 温度高于900, 5轴位移台	衬底尺寸可以调整
	镀膜室真空度: 小于 5×10^{-6} Pa	可选择抽气方式
	工作气体: 2路、质量流量计控制	根据需要可调整
	准备室: 真空度小于 5×10^{-5} Pa, 磁力传送机构	可增添其它机构
尺寸及电源	尺寸: 150 (长) X120 (宽) X200 (高) CM 电源: 单相 220V 60A	选配: RHEED图像处理软件, 活化离子源, 红外温度仪, 镀膜软件等